

ДИНАМИКА НЕЛИНЕЙНОЙ РЕФРАКЦИИ В СТРУКТУРАХ С КВАНТОВЫМИ ЯМАМИ $\text{PbTe/Pb}_{1-x}\text{Sn}_x\text{Te}$

Гуменюк-Сычевская Ж. В., Сизов Ф. Ф.

Проведен анализ динамики нелинейной рефракции $n(t) = f(I)$ под действием импульсного излучения CO_2 -лазера в структурах с квантовыми ямами на основе соединений $\text{PbTe/Pb}_{1-x}\text{Sn}_x\text{Te}$ ($x=0.2$) на подложках (111) BaF_2 . Показано, что изменения dn/dI происходят гораздо быстрее, чем в монокристаллических слоях $\text{Pb}_{1-x}\text{Sn}_x\text{Te}$, что обусловлено наличием ступенчатой функции плотности состояний в структурах с квантовыми ямами. Такие структуры могут быть использованы в качестве эффективных ИК оптических переключателей и бистабильных элементов.

Полупроводниковые квантово-размерные структуры и прежде всего сверхрешетки (СР) и структуры с многократными квантовыми ямами (МКЯ) перспективны для целей оптоэлектроники как эффективные излучатели и фотоприемники. В то же время они могут быть использованы и в качестве управляющих элементов (модуляторов, дефлекторов и др.) потоков излучения, обусловленных изменениями оптических характеристик под действием внешних полей. Большие изменения коэффициента поглощения и показателя преломления в СР и МКЯ в области экситонного поглощения в видимой и ближней ИК области спектра установлены в полупроводниках группы $\text{A}^{\text{III}}\text{B}^{\text{V}}$ (см., например, [1]). Такие изменения оптических характеристик в МКЯ и СР могут быть достигнуты при меньших плотностях мощности оптического возбуждения или при более высоких температурах по сравнению с объемными полупроводниками. В ИК диапазоне длин волн $\lambda \approx 10$ мкм нелинейные оптические элементы могут быть использованы в качестве оптических переключателей, бистабильных устройств и т. п., для чего можно использовать МКЯ на основе узкозонных полупроводников $\text{A}^{\text{IV}}\text{B}^{\text{VI}}$. В этих полупроводниках можно ожидать проявления больших оптических нелинейностей, связанных с динамическим эффектом Бурштейна—Мосса вследствие малых значений эффективных масс носителей и относительно больших времен рекомбинации фотовозбужденных электронов.

Рассмотрим нелинейную рефракцию, связанную с динамическим эффектом Бурштейна—Мосса в МКЯ типа $\text{PbTe/Pb}_{1-x}\text{Sn}_x\text{Te}$ ($x=0.2$), выращенных в плоскости (111) на подложках BaF_2 , с учетом реальной зонной структуры этих систем. В указанных соединениях экстремумы c - и v -зон расположены в точке L зоны Бриллюэна. Поэтому необходимо учитывать вклады в коэффициент поглощения света от электронных переходов из состояний в каждой из четырех долин, которые в СР и МКЯ становятся неэквивалентными и размерное квантование в них существенно разное (см., например, [2]) вследствие значительной анизотропии эффективных масс электронов и дырок. Предполагается, что накачка осуществляется второй гармоникой CO_2 -лазера ($\hbar\omega_2 \cong 0.236$ эВ), которую можно получить, используя слоистые кристаллы GaSe [3]. Эта энергия меньше ширины запрещенной зоны PbTe при $T=150$ К ($E_g=0.245$ эВ), но попадает в область межзонного поглощения слоев $\text{Pb}_{1-x}\text{Sn}_x\text{Te}$ ($x=0.2$) ($E_g = -0.139$ эВ). Зондирующий импульс CO_2 -лазера ($\hbar\omega_1 \cong 0.118$ эВ) имеет частоту меньше ширины запрещенной зоны $\text{Pb}_{1-x}\text{Sn}_x\text{Te}$. Импульс накачки и зондирующий импульс имеют одинаковую треугольную форму и длительность

$\tau_s \approx 100$ нс. Каждый фотон накачки при межзонном поглощении в МКЯ рождает одну электронно-дырочную пару. Коэффициент поглощения имеет вид

$$\alpha(\hbar\omega, z, t) = \alpha_0(\hbar\omega) (1 - f_e(z, t) - f_h(z, t)), \quad (1)$$

где $f_{e, h}$ — функции распределения электронов и дырок. Для МКЯ типа I (экстремумы зоны проводимости и валентной зоны $\text{Pb}_{1-x}\text{Sn}_x\text{Te}$ попадают в запрещенную зону PbTe) правило отбора для переходов между мини-зонами валентной зоны и зоны проводимости: $n_c - n_v = 0$; а коэффициент линейного поглощения излучения $\alpha_0(\hbar\omega)$ имеет вид ступенчатой функции [2]

$$\alpha_0(\hbar\omega) = \frac{\pi^2 e^2 \hbar}{4m_0^2 \epsilon_\infty^{1/2} a} \left[\frac{(\epsilon P_{cz}^1)^2}{P_1^2} \sum_n \Theta(\omega - \omega_n) (1 - \Delta_n) + \sum_{q=2}^4 \frac{(\epsilon P_{cx}^q)^2}{\tilde{P}_x \tilde{P}_y} \sum_{n'} \Theta(\omega - \omega_{n'}) [1 - \Delta_{n'} + O(\Delta_{n'}^2)] \right].$$

Здесь P_{cz}^q — оптический матричный элемент для q -й долины, P_1 , \tilde{P}_x и \tilde{P}_y — дипольные матричные элементы, перпендикулярные оси структуры для $[111]$ и $[\langle 1\bar{1}1 \rangle]$ долин соответственно, $\Theta(\omega - \omega_n)$ — ступенчатая функция, a — ширина ямы. В этом выражении $\Delta_n = (E_{cn}^2 - E_{vn}^2)^2 / \hbar^4 \omega^4 \ll 1$, так как для ям PbSnTe $m_e \approx m_h$ и разрывы обеих зон на гетеропереходе сравнимы по величине.

Предполагается, что передняя грань образца освещается равномерно, а диффузия вдоль оси системы z (ось $[111]$), вдоль нее же распространяется свет) отсутствует из-за наличия барьеров PbTe .

Здесь мы пренебрегаем перенормировкой ширины запрещенной зоны, поскольку при концентрациях свободных носителей, генерируемых импульсами накачки ($N_e, N_h \ll \approx 5 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$), она незначительна. Так же игнорируются процессы нагрева структуры. При мощностях $I \approx 5 \cdot 10^4 \text{ Вт/см}^2$ и длительностях импульса накачки $\tau_i \approx 100$ нс для реальных параметров слоев PbSnTe при $T = 150 \text{ К}$ ($\chi = K/\rho C_p \approx 0.3 \text{ см}^2/\text{с}$ — коэффициент температуропроводности, K — коэффициент теплопроводности, C_p — теплоемкость, ρ — плотность) можно оценить повышение температуры на глубине z в образце под действием лазерного импульса при условии сильного поглощения до момента просветления. Оценки изменения температуры структур не превышают $1.5 - 2.0 \text{ К}$ и выполнены с использованием выражения [4]

$$T = T_0 + \frac{2I(1-R)}{\pi^{1/2} K} (\chi \tau_i) \operatorname{erfc} \left(\frac{z}{2(\chi \tau_i)^{1/2}} \right), \quad (2)$$

справедливого при вышеуказанных предположениях. Здесь R — коэффициент отражения ($R \approx 0.5$).

На основании экспериментальных данных [5, 6] полагается, что преобладающим механизмом рекомбинации в СР и СКЯ $\text{PbTe}/\text{PbSnTe}$ является излучательная рекомбинация. В соответствии со статистикой Русбрека—Шокли время жизни для излучательной рекомбинации зависит от концентрации неравновесных носителей Δ [7]:

$$\tau = \tau_0 \frac{N_{h0} + N_{e0}}{N_{h0} + N_{e0} + \Delta}, \quad \tau_0 \sim \frac{1}{N_{e0} E_g^2}. \quad (3)$$

Здесь N_{h0} и N_{e0} — равновесные концентрации носителей. При больших уровнях накачки $\tau \approx \Delta^{-1}$.

Поскольку время релаксации по импульсу ($\tau \approx 10^{-12} \text{ с}$) много меньше времени межзонной рекомбинации в слоях $\text{Pb}_{1-x}\text{Sn}_x\text{Te}$ ($x \leq 0.2$, $\tau \geq 10^{-9} \text{ с}$), неравновесные носители успевают термализоваться и для них можно говорить о квазиуровне Ферми.

Уравнение баланса для концентрации неравновесных носителей Δ в этом случае будет иметь вид

$$\frac{d\Delta(z, t)}{dt} = \frac{\alpha_0 (\hbar\omega_2) (1 - f_e(z, t) - f_h(z, t)) I(z, t)}{\hbar\omega_2} - \frac{\Delta(z, t)}{\tau(\Delta(z, t))} + \frac{\alpha (\hbar\omega_1) I_{\text{probe}}}{\hbar\omega_2}, \quad (4)$$

а уравнение для распределения интенсивности света вдоль оси распространения имеет вид

$$\frac{dI(z, t)}{dz} = -\alpha(\hbar\omega, z, t) I(z, t), \quad (5)$$

где $I(z=0, t) = (1-R)I_{\text{max}} i(t)$. В последнем выражении $i(t)$ — форма импульса. В (4) последним слагаемым можно пренебречь, поскольку $\alpha(\hbar\omega_1) \ll \alpha(\hbar\omega_2)$ и $I_{\text{probe}} \ll I$.

В твердых растворах халькогенидов свинца эффективные массы электронов и дырок приблизительно равны друг другу, поэтому изменения функций распределения носителей обоих типов также равны: $\delta f_e \cong \delta f_h$, и в (4) ни одной из этих функций пренебречь нельзя в отличие от полупроводников AlPbV .

В уравнении (4) $\Delta = \Delta N_e + \Delta N_h$, где каждое из слагаемых определяется выражением

$$\Delta N_{e,h}(z, t) = \int g_{e,h}(E) \{f_{e,h}(E_{E_{e,h}}^*(z, t)) - f_{e,h}(E_F)\} dE, \quad (6)$$

где $g(E)$ — плотность состояний в МКЯ, вычисленная в рамках двузонной модели:

$$g(E) = \frac{(E + E_g/2)}{\pi a} \left(\frac{1}{P_x^2} \sum_n \Theta(E - E_n) + \frac{3}{\tilde{P}_x \tilde{P}_y} \sum_{n'} \Theta(E - E_{n'}) \right). \quad (7)$$

Для значений квазиуровня Ферми $|E_F^*| > |x_{n,n'}| + kT$ использовалась статистика Ферми—Дирака, и концентрация дырок в n -й мини-зоне валентной зоны для долины $[111]$ равна

$$N_{hn} = \frac{1}{2\pi a P_x^2} f_h(E_F^* - x_n) (E_F^{*2} - x_n^2),$$

где

$$x_n = -\sqrt{E_g^2/4 + E_n^2}, \quad (8)$$

E_n — положение мини-зоны при $k_x = 0$, отсчитанное от края зоны, E_F^* отсчитывается от середины запрещенной зоны. Для n' -й мини-зоны в трех наклонных $\langle 111 \rangle$ долинах

$$N_{hn'} = \frac{1}{2\pi a \tilde{P}_x \tilde{P}_y} f_h(E_F^* - \tilde{x}_{n'}) (E_F^{*2} - \tilde{x}_{n'}^2), \quad \tilde{x}_{n'} = -\sqrt{E_g^2/4 + E_{n'}^2} (1 - \tilde{P}_{zy} / (\tilde{P}_x^2 \tilde{P}_y^2)). \quad (9)$$

Если $|x_{n,n'}| + kT > |E_F^*|$, то использовалась статистика Больцмана, и для долины $[111]$

$$N_{n'} = \frac{1}{\pi a P_x^2} f_h(E_F^* - \tilde{x}_{n'}) (kT \tilde{x}_{n'} + (kT)^2), \quad (10)$$

а для трех $\langle 111 \rangle$ долин

$$N_{hn'} = \frac{3}{\pi a \tilde{P}_x \tilde{P}_y} f_h(E_F^* - \tilde{x}_{n'}) (kT \tilde{x}_{n'} + (kT)^2). \quad (11)$$

Общая концентрация дырок

$$N_h = \sum_n N_{hn} + \sum_{n'} N_{hn'}.$$

Используя все эти выражения, уравнение (4) можно численно решить относительно квазиуровня Ферми и из (6) вычислить $N_{e,h}(t)$.

Динамика изменения показателя преломления определяется стандартным выражением, определяющим вклад свободных носителей в показатель преломления:

$$n^2(\omega_1) = \epsilon_\infty [1 - (\hbar\omega_p(t)/\hbar\omega_1)^2], \quad (12)$$

где плазменная частота $\omega_p(t) = \left(\frac{4\pi e^2 N_h(t)}{\epsilon_\infty m^*}\right)^{1/2}$, а $m^* = m_t \frac{3K}{2K+1} (1 + 2E_F/E_g) -$ эффективная масса плотности состояний на квазиуровне Ферми и $K = m_l/m_t \approx 10$ (m_l , m_t — продольная и поперечная массы).

Изменения показателя преломления могут быть вычислены по формулам Крамера—Кронига, но такие расчеты приводят к неправдоподобно большим значениям нелинейной рефракции. Возможной причиной этого является то, что при интегрировании учитывалась лишь реальная зонная структура вблизи экстремумов I_6^\pm в PbSnTe.

Расчеты $n(I)$ были выполнены для различных длительностей импульса и различных интенсивностей импульса накачки для структуры из 100 квантовых ям толщиной $a=300$ Å.

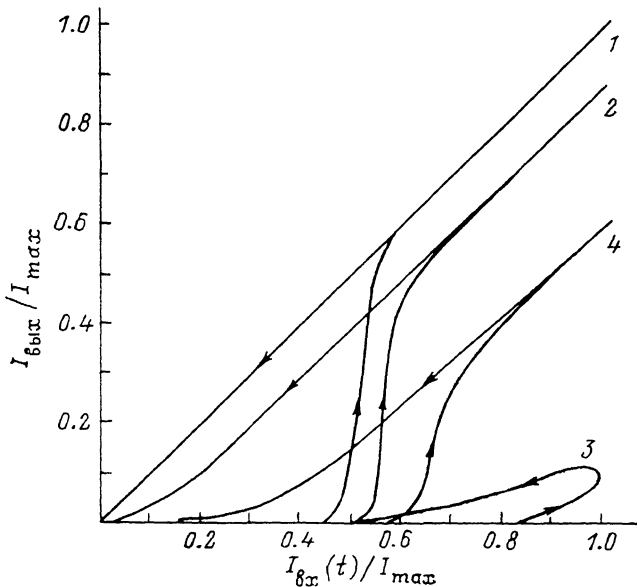


Рис. 1. Зависимость выходной интенсивности от входной для МКЯ р-типа, $N_{h0} = 3.5 \cdot 10^{17}$ см⁻³ при $T = 150$ К, $\tau_i = 50$ нс, $I_{max} = 5 \cdot 10^4$ Вт/см².

1 — $\tau_0 = \infty$, 2 — $\tau_0 = 20$ нс, $\tau = \text{const}$, 3 — $\tau_0 = 20$ нс, $\tau = f(\Delta)$, 4 — $\tau_0 = 50$ нс, $\tau = f(\Delta)$.

На рис. 1 представлена динамика просветления образца для различных времен жизни неравновесных носителей. По осям отложены $I_{вх}(t)/I_{max}$ и $I_{вых}(t)/I_{max}$ импульса накачки в относительных единицах ($I_{max} = 5 \cdot 10^4$ Вт/см²). Расчет выполнен для типичных МКЯ, в которых слои PbSnTe имеют дырочную проводимость $N_{h0} = 3.5 \cdot 10^{17}$ см⁻³ при $T = 150$ К [8]. Кривая 1, рассчитанная без учета рекомбинации ($\tau_0 = \infty$), аналогична кривым, полученным в том же приближении в рамках феноменологической модели [9]. Момент просветления структуры совпадает с моментом достижения фронтом прозрачности задней грани структуры. Структура остается полностью прозрачной и после окончания импульса. Кривая 2 рассчитана в предположении постоянства времени жизни ($\tau_0 = 20$ нс). Просветление наступает позже, чем для случая 1, и заканчивается до окончания импульса. При расчете кривых 3, 4 предполагалось, что время жизни зависит от концентрации неравновесных носителей согласно (3). При росте концентрации носителей на порядок время жизни падает на порядок, что сильно меняет условия просветления. Так, для кривой 3 ($\tau_0 = 20$ нс) фронт прозрачности достигает задней грани образца уже на спаде импульса, и за время импульса образец не успевает полностью просветлиться. При $\tau_0 = 50$ нс (кривая 4) фронт прозрачности достигает задней грани на переднем фронте импульса, однако из-за быстрой рекомбинации носителей образец просветляется слабее, чем в случаях 1, 2. Аналогичная ситуация наблюдается при

$\tau_0 \gg \tau_i$ (как для собственного полупроводника), поэтому рекомбинацию не-обходимо учитывать и в этом случае.

На рис. 2 представлена динамика изменения показателя преломления в МКЯ при тех же τ_i , N_{h0} и I_{max} , что и на рис. 1 для различных начальных времен жизни носителей. Из сравнения $n(I)$ и положения квазиуровня Ферми видно, что резкий скачок n происходит в момент пересечения E_F^* квантового уровня в КЯ (эти моменты показаны стрелками). Особенно эти скачки видны для долин $\langle 111 \rangle$, в которых плотность состояний на уровне значительно больше, чем в долине $[111]$. Скачки n для некоторых уровней неразличимы между собой, потому что при большой скорости нарастания фронта импульса накачки E_F^* пересекает некоторые уровни за промежутки времени $\ll \tau_i$. Чем больше τ_0 , тем степень просветления структуры выше. Сечение рефракции в этом случае

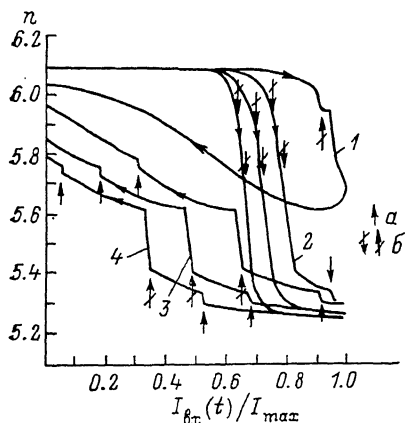


Рис. 2. Динамика изменения показателя преломления для разных τ_0 для МКЯ p -типа, $N_{h0} = 3.5 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$ при $T = 150 \text{ К}$, $\tau_i = 50 \text{ нс}$, $I_{max} = 5 \cdot 10^4 \text{ Вт/см}^2$.
 τ_i , нс: 1 — 20, 2 — 30, 3 — 40, 4 — 50.
Долины: а — $[111]$, б — $\langle 111 \rangle$.

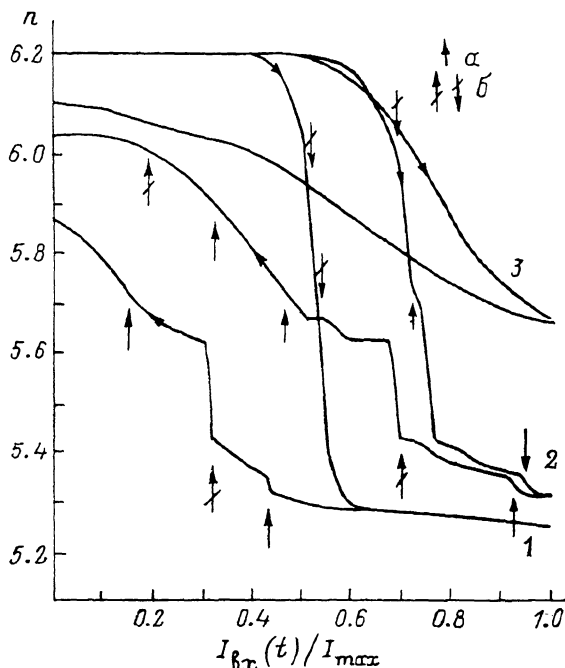


Рис. 3. Динамика изменения показателя преломления в зависимости от τ_i и I_{max} при постоянной энергии в импульсе для случая собственной проводимости.

$T = 150 \text{ К}$, $\tau_0 = 2000 \text{ нс}$, $\tau_i = f(\Delta)$. τ_i , нс: 1 — 50, 2 — 100, 3 — 50 (пленка $\text{Pb}_{1-x}\text{Sn}_x\text{Te}$). I_{max} , Вт/см^2 : 1, 3 — 10^3 , 2 — $5 \cdot 10^4$. Долины: а — $[111]$, б — $\langle 111 \rangle$.

$\sigma \cong 3 \cdot 10^{-19} \text{ см}^3$, что хорошо согласуется с расчетными данными $^{[10]}$ в монокристаллических слоях $\text{Pb}_{1-x}\text{Sn}_x\text{Te}$.

На рис. 3 сравниваются зависимости $n(I)$ для МКЯ $\text{PbTe/Pb}_{1-x}\text{Sn}_x\text{Te}$ ($x = 0.2$) (кривые 1, 2) и пленки (с параболическим законом дисперсии) (3) $\text{Pb}_{1-x}\text{Sn}_x\text{Te}$. Видно, что при одинаковых условиях изменения $n(I)$ для МКЯ происходят гораздо быстрее, чем в пленке, что обусловлено ступенчатым изменением плотности состояний в МКЯ и, как следствие, — ступенчатым изменением коэффициента поглощения в процессе просветления. Кривые 1 и 2 рассчитаны для одинаковых энергий в импульсе, но разных τ_i . Видно, что площадь петли тем больше, чем короче импульс, так как процессы релаксации системы в этом случае оказываются слабее.

Таким образом, МКЯ могут быть использованы в качестве эффективных ИК оптических переключателей и бистабильных элементов, поскольку ожидаемые изменения dn/dI в них гораздо выше, чем в объемных образцах, что связано с наличием ступенчатой функции плотности состояний в МКЯ. Эффективность переключения в таких структурах можно регулировать изменением плотности мощности и длительности импульса накачки.

Список литературы

- [1] Chemla D. S., Miller D. A., Smith P. W. // *Semicond. and Semimet.* / Ed. by R. Dingle. 1987. V. 27. P. 279.
- [2] Гуменюк-Сычевская Ж. В., Сизов Ф. Ф. // *УФЖ.* 1989. Т. 34. В. 12. С. 1811—1816.
- [3] Погосян Д. Н. // *Квант. электрон.* 1977. Т. 4. В. 1. С. 5—13.
- [4] Von Allmen M. *Laser Beam Interactions with Materials.* 1987, Berlin.
- [5] Heuven T. T., Hagerott M., Nurmikko A. V., Partin D. L. // *Appl. Phys. Lett.* 1989. V. 54. N 7. P. 653—655.
- [6] Валейко М. В., Засавицкий И. И., Матвеевко А. В., Мацонашвили Б. Н., Саксеев Д. А. // *ФТП.* 1987. Т. 21. В. 1. С. 34—38.
- [7] Блейкмор Дж. *Статистика электронов в полупроводниках.* М., 1964. 320 с.
- [8] Sizov F., Aratskaya M., Gumenjuk-Sichevskaya J., Teterkin V., Troyan Y. // *Semicond. Sci. Techn.* 1990. V. 5. N 9.
- [9] Кочелап В. П., Кулиш Н. Р., Лисица М. П., Малыш Н. И., Соколов В. Н. // *ФТП.* 1988. Т. 22. В. 5. С. 868—874.
- [10] Paskov P. P., Pavlov L. I., Atanasov P. A. // *Phys. St. Sol. (b).* 1988. V. 149. N 2. P. 739—746.

Институт полупроводников АН УССР
Киев

Получена 9.10.1990
Принята к печати 28.01.1991